

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 04-247486
(43)Date of publication of application : 03.09.1992

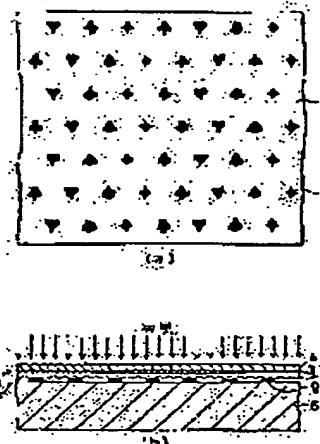
(51)Int.CI. G03H 1/20
B44C 5/08
G03H 1/02
G03H 1/18

(21)Application number : 03-012183 (71)Applicant : DAINIPPON PRINTING CO LTD
(22)Date of filing : 01.02.1991 (72)Inventor : TAWARA SHIGEHIKO

(54) TRANSFER FOIL OF REFLECTION TYPE RELIEF HOLOGRAM AND SELECTIVE TRANSFER METHOD OF REFLECTION TYPE RELIEF HOLOGRAM USING THIS

(57)Abstract:

PURPOSE: To simply and easily form transfer hologram patterns of fine patters in a large area.
CONSTITUTION: Adhesives 9 are selectively applied to the selective pattern regions on the surface of a base body 6 or the surface of the reflection layer of the transfer foil and the reflection layer of the transfer foil is superposed toward the surface of the base body and a base film 4 is peeled after the solidification of the adhesives in order to selectively transfer the reflection type relief holograms on the arbitrarily selected patterns on the surface of the base body 6 by using the transfer foil 10 consisting of a resin layer 1 formed with fine rugged patterns of relief holograms, etc., on the surface, the reflection layer 2 formed on the rugged surface thereof and the base film 4 which is provided on the surface of the resin layer on the side opposite from the reflection layer and is laminated via a release layer 3. The reflection type relief holograms are selectively transferred only in the regions coated with the adhesives in such a manner.



LEGAL STATUS

- [Date of request for examination]
- [Date of sending the examiner's decision of rejection]
- [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
- [Date of final disposal for application]
- [Patent number]
- [Date of registration]
- [Number of appeal against examiner's decision]

[of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平4-247486

(43) 公開日 平成4年(1992)9月3日

(51) Int.Cl.
G 03 H 1/20
B 44 C 5/08
G 03 H 1/02
1/18

識別記号
8106-2K
6578-3K
8106-2K
8106-2K

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数9(全9頁)

(21) 出願番号 特願平3-12183
(22) 出願日 平成3年(1991)2月1日

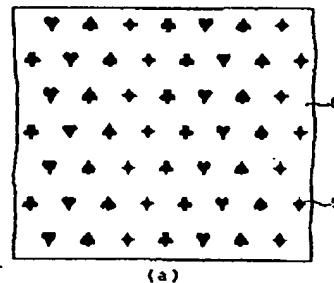
(71) 出願人 000002897
大日本印刷株式会社
東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
(72) 発明者 田原茂彦
東京都新宿区坂町7番地大日本印刷株式会社内
(74) 代理人 弁理士 藤澤 弘 (外7名)

(54) 【発明の名称】 反射型レリーフホログラムの転写法及びそれを用いた反射型レリーフホログラムの選択的転写方法

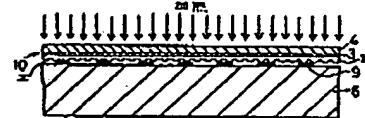
(57) 【要約】

【目的】 大きな面積に細かい模様の転写ホログラムパターンを手軽に形成することができるようとする。

【構成】 表面にレリーフホログラム等の微細な凹凸パターンが形成された基盤1と、その凹凸面に形成された反射層2と、該反射層の反射層と反対側の面に設けられた剥離層3を介して積層されたベースフィルム4となる転写箔10を用いて基体6表面の任意の選択パターン上に反射型レリーフホログラムを選択的に転写するためには、基体表面若しくは転写箔の反射層表面の選択パターン領域に接着剤9を選択的に塗布し、転写箔の反射層を基体表面に向けて重ね合わせ、接着剤固化後にベースフィルムを剥離する。こうして、接着剤塗布領域においてのみ選択的に反射型レリーフホログラムを転写する。



(a)



(b)

図 3

【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも表面にレリーフホログラム、レリーフ回折格子等の複雑な凹凸パターンが形成された樹脂層と、その凹凸面に形成された反射層と、樹脂層の反射層と反対側の面に積層された剥離性ベースフィルムとかなることを特徴とする反射型レリーフホログラムの転写法。

【請求項2】反射層の樹脂層と反対側の面に保護樹脂層が積層されていることを特徴とする請求項1記載の反射型レリーフホログラムの転写法。

【請求項3】請求項1又は2記載の反射型レリーフホログラムの転写法を用いて被転写基体表面の任意の選択パターン上に反射型レリーフホログラムを選択的に転写する方法において、被転写基体表面若しくは転写法の反射層又は保護樹脂層表面の選択的パターン領域に接着剤を選択的に塗布し、転写法の反射層又は保護樹脂層を被転写基体表面に向けて重ね合わせ、接着剤にベースフィルムを剥離することにより、接着剤塗布領域においてのみ選択的に反射型レリーフホログラムを転写することを特徴とする反射型レリーフホログラムの選択的転写方法。

【請求項4】請求項1又は2記載の反射型レリーフホログラムの転写法を用いて被転写基体表面の任意の選択パターン上に反射型レリーフホログラムを選択的に転写する方法において、被転写基体表面若しくは転写法の反射層又は保護樹脂層表面の一方の面全面に接着剤を塗布し、他方の面の選択パターン領域にインキを選択的に塗布し、転写法の反射層又は保護樹脂層を被転写基体表面に向けて重ね合わせ、接着後にベースフィルムを剥離することにより、インキ塗布領域においてのみ選択的に反射型レリーフホログラムを転写することを特徴とする反射型レリーフホログラムの選択的転写方法。

【請求項5】請求項1又は2記載の反射型レリーフホログラムの転写法を用いて被転写基体表面の任意の選択パターン上に反射型レリーフホログラムを選択的に転写する方法において、被転写基体表面若しくは転写法の反射層又は保護樹脂層表面の一方の面全面に接着剤を塗布し、その上の選択パターン領域又は他方の面の選択パターン領域にインキを選択的に塗布し、転写法の反射層又は保護樹脂層を被転写基体表面に向けて重ね合わせ、接着後にベースフィルムを剥離することにより、インキの塗布されていない領域においてのみ選択的に反射型レリーフホログラムを転写することを特徴とする反射型レリーフホログラムの選択的転写方法。

【請求項6】前記接着剤が、瞬時接着剤、感熱接着剤、感圧接着剤、又は、トナーであることを特徴とする請求項3から5の何れか1項記載の反射型レリーフホログラムの選択的転写方法。

【請求項7】被転写基体表面若しくは転写法の反射層又は保護樹脂層表面の選択パターン領域に熱可塑性接着

樹脂とぬれ性のあるインキを選択的に塗布し、インキパターンが早く前に熱可塑性接着樹脂からなるパウダーを振りかけ、インキパターンに接觸していないパウダーを振り落として所定パターン部分にのみ熱可塑性接着樹脂パウダーを分布させ、インキが乾いてから転写法の反射層又は保護樹脂層を被転写基体表面に向けて重ね合わせることを特徴とする請求項3記載の反射型レリーフホログラムの選択的転写方法。

【請求項8】請求項1又は2記載の反射型レリーフホ

10 ログラムの転写法を用いて被転写基体表面の任意の選択パターン上に反射型レリーフホログラムを選択的に転写する方法において、被転写基体表面若しくは転写法の反射層又は保護樹脂層表面の選択的パターン領域に接着剤を選択的に塗布し、転写法の反射層又は保護樹脂層を被転写基体表面に向けて重ね合わせ、接着剤にベースフィルムを剥離することにより、接着剤塗布領域においてのみ選択的に反射型レリーフホログラムを転写することを特徴とする反射型レリーフホログラムの選択的転写方法。

【請求項9】請求項1又は2記載の反射型レリーフホログラムの転写法を用いて被転写基体表面の任意の選択パターン上に反射型レリーフホログラムを選択的に転写する方法において、被転写基体表面若しくは転写法の反射層又は保護樹脂層表面の一方の面全面に丙烯酸を塗布塗装し、その上の選択パターン領域又は他方の面の選択パターン領域に丙烯酸用の溶剤又は溶剤を含むインキを選択的に塗布し、溶剤又はインキが早く前に転写法の反射層又は保護樹脂層を被転写基体表面に向けて重ね合わせ、丙烯酸が固化した後にベースフィルムを剥離することにより、溶剤塗布領域においてのみ選択的に反射型レリーフホログラムを転写することを特徴とする反射型レリーフホログラムの選択的転写方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、特定の転写タイプに構成された反射型レリーフホログラムの転写法及びそれを用いた反射型レリーフホログラムの選択的転写方法に関する。特に、大きな面積に微細なホログラムパターンを容易に転写できる転写法と転写方法に関する。

【0002】

【従来の技術】ホログラムは、一般に光の干渉パターンを記録したものであり、二次元図像、三次元図像の記録、表示をはじめ、高密度の情報記録媒体として多方面に用いられている。この中、レリーフホログラムは、フォトレジスト等にホログラムの干渉線を凹凸パターンとして記録した後、この凹凸パターンをメッキ等により型取りし、この企型を透明な熱可塑性樹脂等又はこのような樹脂表面に金属等からなる反射層を形成したものに型押しすることにより、大量に複製される。レリーフホロ

グラムの中、レリーフ面に金属層、高周折率層等の反射層を設け、この反射層から反射回折された光によって像を再生するものは、反射層によって入射光をほぼ完全に反射する場合と、入射光の一部を反射し、透過した背景にホログラム再生像が重なる場合とがある。本願においては、これら両者を含めて反射型レリーフホログラムと呼ぶことにする。また、凹凸パターンが単に位相回折格子模様を適当に並べたパターンの場合もあるが、これも上記反射型レリーフホログラムに含めて考える。

【0003】反射型レリーフホログラムは、典型的には図4に示したような断面構造をしており、熱可塑性樹脂等からなるホログラム層1とその表面の凹凸干涉模様(レリーフ層)上に形成された反射層2からなり、反射層2はアルミニウム、スズ等の導電金属膜からなる場合と硬化亜鉛等の高屈折率透明体膜からなる場合がある。蒸着金属膜からなる場合は、金属により入射光をほぼ完全に反射する反射型レリーフホログラムとなるが、高屈折率透明体膜からなる場合は、ホログラム層1と反射層2の間の屈折率差に基づくフレネル反射によるため、入射光の一部を反射し透過した背景にホログラム再生像が重なるタイプの反射型レリーフホログラムとなる。このような反射型レリーフホログラムの製造方法としては、フォトレジスト等にホログラム情報を凹凸のパターンとして記録した後、この凹凸パターンをメッキ等により型取りし、この金型をホログラム層1を形成する透明な樹脂層に壓押しをして複製し、その複製された凹凸模様上に反射層2を蒸着等により形成することにより製造する方法と、予めホログラム層1を形成する透明な樹脂層上に反射層2を蒸着等により形成しておき、その反射層2上に上記のような凹凸パターンを型取りした金型を加熱加圧して複製して製造する方法(例えば、特開昭58-65465号公報参照)とがある。

【0004】ところで、このような反射型レリーフホログラムを転写法で構成することができる。図5にその断面を示す。図4の反射型レリーフホログラムを転写可能にするためには、ホログラム層1の反射層2と反対の面にワックス等からなる剥離層3を介してPBT(ポリエチレンテレフタート)等からなるベースフィルム4を設け、また、反射層2上に塩化ビニル系樹脂等からなる感熱接着層5を設ける。このような構成の転写法の所望の輪郭領域部分内のホログラム層1及び反射層2を、例えばホットスタンプ装置を用いて例えば塩化ビニル等からなる基材上に転写するには、図6に示すように、転写される基材6とホットスタンプ熱型7の間に感熱接着層5が基材6に向き、ベースフィルム4がホットスタンプ熱型7に対向するように転写法をセットして、ホットスタンプ熱型7を加熱加圧すればよい。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】ところで、従来は図6に示すようにしてホットスタンプ装置で反射型レリーフ

ホログラムを基材6上に転写していたが、転写されたホログラムのパターンはホットスタンプの熱型により決定され、パターンの変更の際は新しい熱型を用はしなければならなかった。また、広い面積を転写する時は、熱型の温度分布や圧力分布が不安定になり、しかも熱型が巨化してしまうという問題があった。

【0006】そこで、上記の問題を解決するために、感熱記録ヘッドを用いた反射型レリーフホログラムの転写が提案された(特開平1-283583号公報参照)。

【0007】しかし、ホットスタンプ装置による転写方法も感熱記録ヘッドによる転写方法も、ベースフィルムのホログラム層と反対側の面から転写ホログラムパターン部分のみを加熱するため、ベースフィルムにおける熱分散現象あるいは圧力分散現象が生じ、所望のパターンの微細な再現が困難であり、微細なパターンの転写に適さなかった。

【0008】本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、大きな面積に細かい模様の転写ホログラムパターンを手軽で容易に形成することができるよう切削された反射型レリーフホログラムの転写法とそれを用いた反射型レリーフホログラムの選択的転写方法を提供することである。

【0009】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成する本発明の反射型レリーフホログラムの転写法は、少なくとも表面にレリーフホログラム、レリーフ回折格子等の微細な凹凸パターンが形成された樹脂層と、その凹凸層に形成された反射層と、樹脂層の反射層と反対側の面に複数された耐熱性ベースフィルムとからなることを特徴とするものである。

【0010】この場合、反射層の樹脂層と反対側の面に保護樹脂層を空出して構成してもよい。

【0011】また、上記の反射型レリーフホログラムの転写法を用いて被転写基材表面の任意の選択パターン上に反射型レリーフホログラムを選択的に転写する方法には、被転写基材表面若しくは転写法の反射層又は保護樹脂層表面の選択的パターン領域に接着剤を選択的に塗布し、該塗布の反射層又は保護樹脂層を被転写基材表面に向けて重ね合わせ、接着後にベースフィルムを剥離することにより、接着剤領域においてのみ選択的に反射型レリーフホログラムを転写する方法、被転写基材表面若しくは転写法の反射層又は保護樹脂層表面の一方の面全面に接着剤を塗布し、他方の面の選択パターン領域にインキを選択的に塗布し、転写法の反射層又は保護樹脂層を被転写基材表面に向けて重ね合わせ、接着後にベースフィルムを剥離することにより、インキ塗布領域においてのみ選択的に反射型レリーフホログラムを転写する方法、被転写基材表面若しくは転写法の反射層又は保護樹脂層表面の一方の面全面に接着剤を塗布し、その上の選択パターン領域にイ

5

ンキを選択的に塗布し、転写層の反射層又は保護樹脂層を被転写基体表面に向けて重ね合わせ、接着後にベースフィルムを剥離することにより、インキの塗布されていない領域においてのみ選択的に反射型レリーフホログラムを転写する方法、があり、前記接着剤は、熱時接着剤、感熱接着剤、感圧接着剤、又は、トナーである。さらに、上記の被転写基体表面若しくは転写層の反射層又は保護樹脂層表面の選択的パターン領域に接着剤を選択的に塗布し、転写層の反射層又は保護樹脂層を被転写基体表面に向けて重ね合わせ、接着後にベースフィルムを剥離することにより、接着剤塗布領域においてのみ選択的に反射型レリーフホログラムを転写する方法において、被転写基体表面若しくは転写層の反射層又は保護樹脂表面の選択パターン領域に熱可塑性接着樹脂とぬれ性のあるインキを選択的に塗布し、インキパターンが乾く前に熱可塑性接着樹脂からなるパウダーを振りかけ、インキパターンに接着していないパウダーを振り落として所望パターン部分にのみ熱可塑性接着樹脂パウダーを分布させ、インキが乾いてから転写層の反射層又は保護樹脂層を被転写基体表面に向けて重ね合わせるようになるとともできる。

【0012】さらにまた、上記の反射型レリーフホログラムの転写層を用いて被転写基体表面の任意の選択パターン上に反射型レリーフホログラムを選択的に転写する方法には、被転写基体表面若しくは転写層の反射層又は保護樹脂層表面の選択的パターン領域に再剥離を選択的に発布乾燥し、再剥離用の溶剤又は溶剤を含むインキを丙酮類又は他方の面に塗った後、転写層の反射層又は保護樹脂層を被転写基体表面に向けて重ね合わせ、丙酮類が固化した後にベースフィルムを剥離することにより、丙酮類塗布領域においてのみ選択的に反射型レリーフホログラムを転写する方法、及び、被転写基体表面若しくは転写層の反射層又は保護樹脂層表面の一方の面全面に丙酮類を塗布乾燥し、その上の選択パターン領域又は他方の面の選択パターン領域に丙酮類用の溶剤又は溶剤を含むインキを選択的に塗布し、溶剤又はインキが乾く前に塗布層の反射層又は保護樹脂層を被転写基体表面に向けて重ね合わせ、丙酮類が固化した後にベースフィルムを剥離することにより、溶剤塗布領域においてのみ選択的に反射型レリーフホログラムを転写する方法、がある。

【0013】

【作用】本発明においては、反射型レリーフホログラムの転写層を、少なくとも表面にレリーフホログラム、レリーフ回折格子等の複雑な凹凸パターンが形成された樹脂層と、その凹凸層に形成された反射層と、樹脂層の反射層と反対側の面に積層された熱可塑性ベースフィルムとから構成し、被転写基体表面若しくは転写層の反射層又は保護樹脂層表面の選択パターン領域に接着剤等を選択的に塗布して接着剤等塗布領域においてのみ選択的に反

射型レリーフホログラムを転写する等しているので、大きな面積に細かい模様の転写ホログラムパターンを手軽で容易に形成することができる。

【0014】

【実施例】次に、図1及び図2を参照にして本発明による反射型レリーフホログラムの転写層について説明する。図1の転写層10は、図5の従来の転写層と比較すると、感熱接着層5が設けられていない点においてのみ相違する。すなわち、熱可塑性透明樹脂等からなるホログラム層1とその表面の凹凸干涉模様面（レリーフ面）上に形成されたアルミニウム、スズ等の蒸着金属膜又は硬化亜鉛等の高屈折率透明成形からなる反射層2とからなる反射型レリーフホログラムが構成されており、さらに、ホログラム層1の反射層2と反対側の間にワックス等からなる剥離層3を介してPET（ポリエチレンテレフタート）等からなるベースフィルム4が設けられている。この場合、反射層2は露出している。この露出した反射層2を保護する目的で、図2に示すように、反射層2上に保護樹脂層8を設けてよい。

【0015】さて、このような転写層10を用いて、任意の基体6上に所望のパターンで反射型レリーフホログラムを転写するには、図3(a)に示すように、まず、孔版印刷、スクリーン印刷、磨き印刷等任意の印刷方法又は手書きで所望のパターン部分に無溶剤型の熱可塑性接着剤9を塗布する。そして、接着剤9が硬化する前に、図1又は図2の転写層10の反射層2側をこの印刷面に重ねて密着させ、接着剤9が硬化してからベースフィルム4を剥離すると、印刷部分にのみ選択的に反射型レリーフホログラムが転写される。したがって、転写されるパターンの大きさは接着剤9の印刷パターンによるため、従来のように感熱記録ヘッドの発熱素子の大きさに依存することはなくなる。また、接着剤9の印刷は広い面に容易に行われるため、転写層10の大きさが必要なだけ大きければ、転写可能な領域にも制限がない。

【0016】また、上記の接着剤9として感熱接着剤9を用い、上記と同様にして基体6上に塗布し、転写層10をその上に重ねてベースフィルム4側からアイロンのような加熱手段により加熱し、接着剤9が硬化してからベースフィルム4を剥離することによっても、同様に感熱記録ヘッドの発熱素子の大きさに依存することはなく、大きな面積に複雑なホログラムパターンを転写することができる。

【0017】ところで、所望のパターンに感熱接着剤を分布させるには、上記のように任意の印刷方法又は手書きで選択的に感熱接着剤を塗布するのではなく、予め基体6上に熱可塑性接着樹脂とぬれ性のあるインクを所望パターンに任意の印刷方法又は手書きで塗布し、そのインクパターンが乾く前に熱可塑性接着樹脂からなるパウダーを振りかけ、インクパターンに接着していないパウダーを振り落として所望パターン部分にのみ熱可塑性接

7

着樹脂パウダー9を分布させ、インクが乾いてから上記と同様に転写箔10をその上に同様に重ねてベースフィルム4側からアイロンのような加熱手段により加熱し、熱可塑性接着樹脂部分9が硬化してからベースフィルム4を剥離するようにしてもよい。

【0018】さらに、図1又は図2の転写箔10の反射層2側全面に感熱接着剤を塗布し、一方、基体6には感熱接着剤と相溶性のあるインキを用いて任意の印刷方法又は手書きで所望パターンを描き、感熱接着剤を全面に塗布した転写箔10をその上に同様に重ねてベースフィルム4側からアイロンのような加熱手段により加熱し、接着剤9が硬化してからベースフィルム4を剥離することによっても、同様に大きな面積に微細なホログラムパターンを転写することができる。また、基体6自身が感熱接着剤と相溶性をもつ場合には、転写箔10に感熱接着剤と相溶性のあるインキによりニガのパターンを形成し、基体6上に転写箔10を重ね合わせ、ベースフィルム4側から加熱手段により熱を加えて感熱接着剤が溶出している部分(ポジパターン)のみに反射型レリーフホログラムを転写するようになることができる。

【0019】また、トナー像を普通用紙に転写するタイプの電子写真複写機においては、通常感熱定着型のトナーが用いられている。これは、感熱粒子を感熱樹脂中に分散させたり、感熱粒子を感熱樹脂で被って形成したものであるため、普通用紙に転写定着されたトナー像部分は感熱接着性がある。したがって、感熱定着型トナーの転写定着によって形成されたパターン上に転写箔10を重ねてベースフィルム4側からアイロンのような加熱手段により加熱すると、パターン領域に反射層2又は保護樹脂層8が接着するので、感熱樹脂が固まってからベースフィルム4を剥離すると、トナーパターン部分にのみ選択的に反射型レリーフホログラムが転写されることになる。この場合は、單にホログラムを転写したいパターン領域をよく洗りつぶした原稿のコピーを電子写真複写機により作成し、その上に転写箔10を重ねて転写すればよく、極めて簡単に反射レリーフホログラムをかいひバターンの選択領域に転写することができる。

【0020】以上、無溶剤型感熱接着剤、感熱接着剤の塗布パターン、熱可塑性接着樹脂パウダーの塗布パターン、感熱接着剤と相溶性のあるインキの塗布パターン、及び、感熱定着型トナーの転写定着像を被転写体上に形成する場合について説明してきたが、これらを転写箔10の反射層2又は保護樹脂層8表面に選択的に形成しても、上記と同様に選択的に反射レリーフホログラムを転写することができる。

【0021】さらに、接着剤として、感熱接着剤の代わりに、感熱接着剤・再溶剤を用いることもできる。感熱接着剤を用いる場合は、図3(b)において、加熱する代わりに、その塗布パターン上に転写箔10を重ね合わせ、ベースフィルム4側から加熱手段により圧力を加え

て感熱接着剤が塗布されている部分のみに反射型レリーフホログラムを転写するようにする。また、感熱接着剤の場合と同様に、転写箔10の反射層2側全面に感熱接着剤を塗布し、この面を感熱接着剤と相溶性のあるインキで印刷した基体6の印刷面上に重ね合わせて加熱し、接着後ベースフィルム4を剥離することによっても、同様に転写できる。さらに、基体6上に感熱接着剤を均一に塗布し、その上に所望のパターンを印刷してインキによりマスクをし、その上に転写箔10を重ね合わせ、ベースフィルム4側から加熱手段により圧力を加えて感熱接着剤が露出している部分のみに反射型レリーフホログラムを転写するようにすることもできる。また、基体6自身が感熱接着剤と相溶性をもつ場合には、転写箔10に感熱接着剤と相溶性のあるインキによりニガのパターンを形成し、基体6上に転写箔10を重ね合わせ、ベースフィルム4側から加熱手段により圧力を加えて感熱接着剤が露出している部分(ポジパターン)のみに反射型レリーフホログラムを転写するようにすることもできる。

【0022】また、再溶剤を用いる場合は、その塗布パターン上に水等の溶媒を全面に塗り、その上に転写箔10を重ねて、糊が乾いてからベースフィルム4を剥離すればよい。また、再溶剤を転写箔10側全面に塗布しておき、基体6上に所望のパターンを水溶液又は水溶性インキで印刷し、印刷部分が乾燥する前に転写箔10の再溶剤を塗布した面を重ね合わせ、糊が乾いてからベースフィルム4を剥離するようにしてよい。

【0023】なお、感熱接着剤・再溶剤の場合も、無溶剤型感熱接着剤、感熱接着剤の場合と同様、上記の例において転写箔10と基体6の関係を逆にすることができる。

【0024】次に、上記転写箔10の各層の材料及びエンボス方法について説明する。このベースフィルム4は、2輪延伸されたポリエチレンテレフタレートフィルムが寸法安定性、耐熱性、強韧性等から最も好ましいが、これ以外に、ポリ塩化ビニルフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリエチレンフィルム、ポリカーボネートフィルム、セロファン、「ビニロン」(高屈)フィルム、アセテートフィルム、ナイロンフィルム、ポリビニルアルコールフィルム、ポリアミドフィルム、ポリアミドミドフィルム等の成形フィルム、及び、コンデンサーペーパー等の紙が使用可能であり、その厚みは6~12μm程度が好ましい。

【0025】剥離層3は、剥離性、格切れ性を向上させる目的で設けられ、ベースフィルム4の種類に応じて既知の各種の材料が利用できる。例えば、ポリメタクリル酸エチル樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、セルロース樹脂、シリコーン樹脂、臭化水素を主体とするワックス類、ポリステレン樹脂、塩化ゴム、カゼイン、各種界面活性剤、金属塗化物等の中、1種もしくは2種類以上を混合した物が用いられ、ベースフィルム4との組み合わ

50

せによってその耐離力が1~5 g/インチ(90度測定)になるようになることが可能である。

【0026】これらの耐離層は、インキ化粧布等の公知の方法により、ベースフィルム4上に薄膜として形成され、その厚みは、耐離力、耐切離性を考慮すると、0.1~1.0 μmの範囲が望ましい。

【0027】ホログラム層1は、耐切離性、転写耐熱性を考慮して各種樹脂材料が選択可能である。具体的には、不飽和ポリエステル樹脂、アクリルウレタン樹脂、エポキシ変性アクリル樹脂、エポキシ変性不飽和ポリエステル樹脂、アクリル酸エステル樹脂、アクリルアミド樹脂、ニトロセルロース樹脂、ポリスチレン樹脂、アルキッド樹脂、フェノール樹脂等の中、1種ないし2種類以上を主体とする物を単独、もしくは、各種イソシアネート樹脂や、ナフテン酸コバルト、ナフテン酸鉄等の金属石鹼、ベンゾイルバーオキサイド、メチルエチルケトンバーオキサイド等の過酸化物、ベンゾフェノン、アセトフェノン、アントラキノン、ナフトキノン、アソビスイソブチルニトリル、ジフェニルスルフィド等の熱あるいは紫外線硬化剤を適量添加した物を用いることができる。

【0028】また、このホログラム樹脂層1は、公知の方法によりインキ化粧布によって形成することが可能であるが、耐切離性(鏡皮破断強度)を0.5~1.0 g/インチにすることを考慮すると、0.5~2.0 μmの厚さの範囲で形成することが望ましい。

【0029】反射層2用の反射性導電層は、金属、金属化合物、ガラス等を基材、スペッター、イオンプレーティング、電解メッキ、無電解メッキ等によりホログラム樹脂層1の表面上に設けられる。

【0030】反射性導電層2としては、ホログラムを反射型とする場合には、光を反射する金属薄膜が用いられ、また、ホログラムを透明型とする場合には、樹脂層1と組み合わさせてホログラム効果を発現し、しかも、下層を遮蔽させないホログラム効果薄膜が用いられ、目的により適宜選択して用いることができる。

| 材質 | n |
|--------|-----|
| Sb; S, | 3.0 |
| Fe; O, | 2.7 |
| PbO | 2.6 |
| ZnSe | 2.6 |
| CdS | 2.6 |
| Bi; O, | 2.4 |
| TiO, | 2.3 |
| PbCl, | 2.3 |
| Cr; O, | 2.3 |
| CeO, | 2.2 |
| Ta; O, | 2.2 |
| ZnS | 2.2 |
| ZnO | 2.1 |

| 材質 | n |
|--------|-----|
| SiO | 2.0 |
| InO, | 2.0 |
| Y; O, | 1.9 |
| TiO | 1.9 |
| ThO, | 1.9 |
| Si; O, | 1.9 |
| PbF, | 1.8 |
| Cd; O, | 1.8 |
| MgO | 1.7 |
| Al; O, | 1.6 |
| LaF, | 1.6 |
| CeF, | 1.6 |
| NdF, | 1.6 |

【0031】反射型ホログラムの場合に用いられる金属薄膜としては、具体的には、Cr、Ti、Fe、Co、Ni、Cu、Ag、Au、Ge、Al、Mg、Sb、Pb、Pd、Cd、Bi、Sn、Se、In、Ga、Rb等の金属及びその酸化物、空化物等を単独もしくは2種類以上組み合せて用いて形成される薄膜である。上記の金属の中、Al、Cr、Ni、Ag、Au等が特に好ましく、膜厚は10~10,000 Å、最もしくは200~2,000 Åであることが望ましい。

【0032】透明型ホログラムの場合に用いられるホログラム効果薄膜は、ホログラム効果を発現できる光透過性のものであればいかなる材質も使用でき、例えば、前記樹脂層1とは屈折率の異なる透明材料、厚みが200人以下の反射性金属薄膜があげられる。前者の場合、屈折率は前記樹脂層1より大きても小さくてもよいが、屈折率の差は0.1以上が好ましく、より好ましくは0.5以上である。本発明者らの実験によれば、1.0以上大きいことが最適である。このように屈折率の異なる透明薄膜層2を設けることにより、ホログラム効果を発現させると共に、下層を遮蔽させない作用が行われる。

【0033】また、後者の場合は、反射性金属薄膜であるが厚みが200 Å以下であるため、光波の透過率が大きく、そのため、ホログラム効果発現作用と共に、透明非遮蔽作用を発揮する。また、膜厚を200 Å以下とすることにより、従来みられた高い輝度の銀灰色による外観上の違和感も解消する。

【0034】導膜層2の材質としては、例えば次の(1)~(6)の材質のものが使用できる。

【0035】(1) 前記樹脂層1より屈折率の大きい透明連続薄膜
これには、可視領域で透明なものと、赤外又は紫外領域で透明なものとがあり、前者は第1表に、後者は第2表にそれぞれ示す。表中、nは屈折率を示す(以下、(2)~(6)においても同様とする。)。

【0036】第1表 可視領域透明体

(7)

特開平4-247486

| | 11 |
|--------------------------------|------|
| CdO | 2. 1 |
| Nd ₂ O ₃ | 2. 1 |
| Sb ₂ O ₃ | 2. 0 |

| | |
|------------------|------|
| SiO ₂ | 1. 5 |
| SiO ₂ | 1. 5 |

第2表 亦外又は紫外領域透明体

材質 n

| | |
|-------------------|-----------|
| CdSe | 3. 5 |
| CdTe | 2. 6 |
| Ge | 4. 0~4. 4 |
| HfO ₂ | 2. 2 |
| PbTe | 5. 6 |
| Si | 3. 4 |
| Te | 4. 9 |
| TiCl ₄ | 2. 6 |
| ZnTe | 2. 8 |

(2) 前記樹脂層1よりも屈折率の大きい透明強硬体を第3表に示す。

【0037】第3表

| 材質 | n |
|--|-----------|
| CuCl | 2. 0 |
| CuBr | 2. 2 |
| GaAs | 3. 3~3. 6 |
| GaP | 3. 3~3. 5 |
| N ₂ (CH ₃) ₂ | 1. 6 |
| B ₂ (GeO ₄) ₂ | 2. 1 |
| KH ₂ PO ₄ (KDP) | 1. 5 |
| KD ₂ PO ₄ | 1. 5 |
| NH ₄ H ₂ PO ₄ | 1. 5 |
| KH ₂ AsO ₄ | 1. 6 |
| RbH ₂ AsO ₄ | 1. 6 |
| KTa _{0.5} Nb _{0.5} O ₃ | 2. 3 |
| K ₂ Li _{0.5} Nb _{0.5} O ₃ | 2. 3 |
| KSr ₂ Nb ₂ O ₇ | 2. 3 |
| Sr ₂ Ba _{1.5} Nb _{0.5} O ₇ | 2. 3 |
| Ba ₂ NaNbO ₆ | 2. 3 |
| LiNbO ₃ | 2. 3 |
| LiTaO ₃ | 2. 2 |
| BaTiO ₃ | 2. 4 |
| SrTiO ₃ | 2. 4 |
| KTaO ₃ | 2. 2 |

(3) 前記樹脂層1よりも屈折率の小さい透明連続薄膜を第4表に示す。

【0038】第4表

| 材質 | n |
|-----------------------|------|
| LiF | 1. 4 |
| MgF ₂ | 1. 4 |
| 3NaF·AlF ₃ | 1. 4 |
| AlF ₃ | 1. 4 |
| NaF | 1. 3 |
| GaP | 1. 3 |

(4) 厚さ200μ以下の反射金属薄膜

反射性金属薄膜は複素屈折率を有し、該複素屈折率: n = n - iKで表される。nは屈折率、Kは吸収係数を示す。本発明に使用される反射性金属薄膜の材質を第5表に示し、同表に併せて上記のn及びKを示す。

【0039】第5表

| 材質 | n | K |
|----|------|------|
| Be | 2. 7 | 0. 9 |
| Mg | 0. 6 | 6. 1 |
| Ca | 0. 3 | 8. 1 |
| Cr | 3. 3 | 1. 3 |
| Mn | 2. 5 | 1. 3 |
| Cu | 0. 7 | 2. 4 |
| Ag | 0. 1 | 3. 3 |
| Al | 0. 8 | 5. 3 |
| Sb | 3. 0 | 1. 6 |
| Pd | 1. 9 | 1. 3 |
| Ni | 1. 8 | 1. 8 |
| Sr | 0. 6 | 3. 2 |
| Ba | 0. 9 | 1. 7 |
| La | 1. 8 | 1. 9 |
| Ce | 1. 7 | 1. 4 |
| Au | 0. 3 | 2. 4 |

その他の材質として、Sn、In、Tc、Fe、Co、Zn、Ge、Pb、Cd、Bi、Se、Ga、Rb等の使用が可能である。また、上記にあげた金属及びその塩化物、空気物等は单独で用いられる他に、それそれを2種以上組み合わせて用いることができる。

【0040】(5) 前記樹脂層1と屈折率の異なる樹脂前記樹脂層1に対して屈折率が大きいものでも小さいものでもよい。これらの例を第6表に示す。

【0041】第6表

| 樹脂 | n |
|-----------------|-------|
| ポリテトラフルオロエチレン | 1. 36 |
| ポリクロルトリフルオロエチレン | 1. 43 |
| 酢酸ビニル樹脂 | 1. 46 |
| ポリエチレン | 1. 52 |
| ポリプロピレン | 1. 49 |
| メチルメタクリレート | 1. 49 |
| ナイロン | 1. 53 |
| ポリステレン | 1. 60 |
| ポリ塩化ビニリデン | 1. 62 |
| ビニルアクリル樹脂 | 1. 48 |
| ビニルホルマール樹脂 | 1. 50 |
| ポリ塩化ビニル | 1. 53 |
| ポリエチル樹脂 | 1. 55 |
| 石炭酸ホルマリン樹脂 | 1. 60 |

50 上記の他、一般的な合成樹脂が使用可能であるが、特

13

に、前記樹脂層1との屈折率差の大きい樹脂が好ましい。

【0042】(6) 上記(1)～(5)の材質を適宜組み合わせてなる複層体上記(1)～(5)の材質の組み合わせは任意であり、また、構成における各層の上下位置関係は任意に選択される。

【0043】上記した(1)～(6)の薄膜層の中、(4)の薄膜層の厚みは200Å以下であるが、(1)～(3)及び(5)、(6)の薄膜層の厚みは薄膜を形成する材質の透明領域であればよく、一般的には、10～1000Åが好ましく、より好ましくは100～500Åである。

【0044】上記ホログラム効果層2を樹脂層1上の形成する方法として、薄膜層2が上記(1)～(4)の材質である場合は、真空蒸着法、スパッタリング法、反応性スパッタリング法、イオンプレーティング法、電気メッキ法等の一般的な薄膜形成手段を用いることができる。また、薄膜層2が上記(5)の材質である場合は、一般的コーティング方法等が用いることができる。薄膜層2が上記(6)の材質である場合は、上記した各手段、方法を適宜組み合わせて用いられる。

【0045】なお、本発明の場合、一般的にはホログラム効果層2の厚さは100～600Åが望ましい。100Å以下であると、反射効果が乏しく、600Å以上であるとエンボス性が著しく低下する。

【0046】このような転写層10をエンボスする企型は従来公知の方法にて作製することができるが、強圧力に耐え、また、表面の微細な凹凸を完全に相手の基材に押し込む必要があるため、十分な硬度と引っ張り強度が必要であり、電解N1メッキ法によって得られたものが最適である。

【0047】このようにして得られたエンボス基材(ベースフィルム4+樹脂層3+ホログラム層1+反射層2)と全空気基材フィルムの反射層2と企型の凹凸面が接するように重ね合わせ、ヒートプレスすることにより、凹凸パターンを反射層2及び樹脂層1に転写して、転写層10が完成する。

【0048】実施例1

1.2μmの厚さのPETからなるベースフィルムの表面に0.5μmの厚さで剥離力5g/インチのワックスからなる剥離層を設け、さらにその上に1.0μmの厚さのアクリルウレタン樹脂からなるホログラム層を塗布し、その上に300Åのアルミニウムを蒸着して、複製前の多孔体を得た。この反射層側に、ニッケルメッキによって作成したレリーフホログラムの企型を加熱、加圧

14

してレリーフホログラムの複型を作成して、反射型レリーフホログラムの転写箔を作成した。

【0049】この転写箔を通常の感熱定着型トナーを用いる電子写真機によるコピー上に重ね合わせ、転写箔側から家庭用アイロンで均一に加熱して、ベースフィルムを剥離したところ、コピーの細かい模様上にも反射型レリーフホログラムが途切れなく転写されていた。

【0050】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の反射型レリーフホログラムの転写箔及びそれを用いた反射型レリーフホログラムの選択的転写方法によると、反射型レリーフホログラムの転写箔を、少なくとも表面にレリーフホログラム、レリーフ凹凸格子等の複雑な凹凸パターンが形成された樹脂層と、その凹凸面に形成された反射層と、樹脂層の反射層と反対側の面上に形成された剥離性ベースフィルムとから構成し、該転写基材表面若しくは転写箔の反射層又は保離樹脂層表面の選択パターン領域に接着剤等を選択的に塗布して接着剤等塗布領域においてのみ選択的に反射型レリーフホログラムを転写する等しているので、大きな面積に細かい模様の転写ホログラムパターンを手軽で容易に形成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による反射型レリーフホログラムの転写箔の1実施例の断面図である。

【図2】本発明による他の実施例の転写箔の断面図である。

【図3】本発明による反射型レリーフホログラムの選択的転写方法の1実施例について説明するための図である。

【図4】典型的な反射型レリーフホログラムの断面構造を示すための図である。

【図5】図4の反射型レリーフホログラムを転写箔に構成した従来例の断面構造を示すための図である。

【図6】図5の転写箔をホットスタンプの熱型を用いて転写する様子を説明するための図である。

【符号の説明】

- 1…ホログラム層
- 2…反射層
- 3…剥離層
- 4…ベースフィルム
- 5…基材
- 6…保護樹脂層
- 7…基材接着剤
- 10…反射型レリーフホログラムの転写箔

(9)

特開平4-247486

【図1】

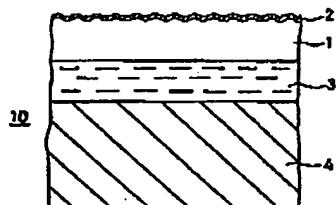


図1

【図2】

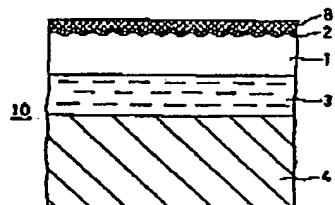
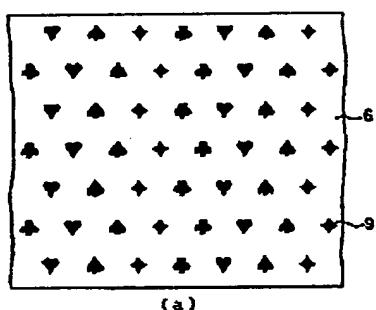
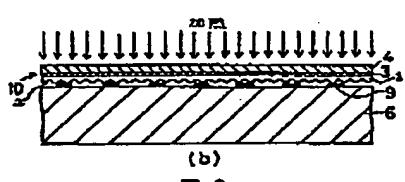


図2

【図3】



(a)



(b)

図3

【図4】



図4

【図5】

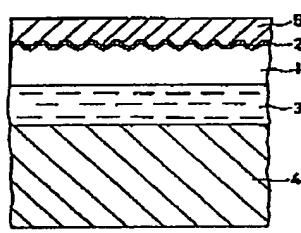


図5

【図6】

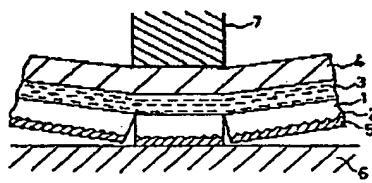


図6